

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-183918
 (43)Date of publication of application : 09.07.1999

(51)Int.Cl.

G02F 1/1339

(21)Application number : 09-356476
 (22)Date of filing : 25.12.1997

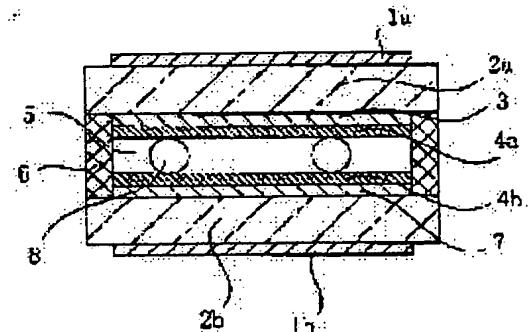
(71)Applicant : SHARP CORP
 (72)Inventor : NAKAYAMA JUNICHIRO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT AND MANUFACTURE THEREFOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent causing the complication of a manufacture process and the increase of equipments by using the photosetting resin of a light trigger type, which starts setting by the irradiation of UV light and successively accelerates setting even when the UV light is interrupted thereafter, for a seal material.

SOLUTION: The seal material 6 is formed at a display area peripheral part on a light shielding substrate 2a where a color part 3 is formed and a spacer 8 is uniformly applied on the light shielding substrate 2b where a TFT part 7 is formed. Then, as soon as the light shielding substrate 2a where the seal material 6 is formed and the light shielding substrate 2b where the TFT part 7 is formed are stuck together, the UV light is instantaneously irradiated from the side of the light shielding substrate 2b where the TFT part 7 is formed to set the seal material 6. When the photosetting resin of an epoxy group with excellent strength and flexibility is used as the seal material 6, the environmental resistance of this liquid crystal display element is improved. Thus, the degradation of an oriented film by the irradiation of the UV light is not caused.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 12.01.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 19.11.2002

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The liquid crystal display component to which said sealant is characterized by consisting of a photo-setting resin of the optical trigger type which sequential hardening promotes even if hardening begins by the exposure of UV light and it intercepts UV light after that in the liquid crystal display component which has the configuration with which the flat-surface substrate of a pair maintained the predetermined gap, and was ***** (ed) by the sealant prepared around it, and liquid crystal was poured into this gap.

[Claim 2] Said sealant is a liquid crystal display component according to claim 1 characterized by being the photo-setting resin of an epoxy system.

[Claim 3] Said sealant is a liquid crystal display component according to claim 1 or 2 characterized by viscosity being 3 - 200 Pa-s.

[Claim 4] One [said] flat-surface substrate is a liquid crystal display component according to claim 1 to 3 to which the flat-surface substrate of these pairs is characterized by *****, now being so that it may be the color filter substrate with which stripe-like a transparent electrode and a color filter were formed, the flat-surface substrate of another side may be a plasma address substrate with which many plasma rooms in which plasma discharge is possible were formed in the shape of a stripe and a transparent electrode and a plasma room may intersect perpendicularly.

[Claim 5] The process which applies to it the photo-setting resin of the optical trigger type which sequential hardening promotes among the flat-surface substrates of a pair even if hardening begins to the periphery of one [at least] substrate and it intercepts UV light to it after that by the exposure of UV light. The manufacture approach of the liquid crystal display component characterized by having the process which UV light is irradiated [process] through said photo-setting resin in an instant at the substrate of the pair ***** (ed) with lamination ***** in the flat-surface substrate of a pair, and stiffens said photo-setting resin.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and INPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the liquid crystal display component suitably used as a flat-panel display, and its manufacture approach.

[0002]

[Description of the Prior Art] It already escapes from the initial stage of a miniaturization, monochrome-izing, and the formation of a binary display, it progresses to enlargement, colorization, a halftone display, animation display, etc., and, as for development of the liquid crystal display component used for a flat-panel display, the increment also of the volume is being enhanced for every year.

[0003] It is as follows when the structure and its manufacture approach of a liquid crystal display component of the active-matrix mold which has the switching element which consists of TFT as one of the liquid crystal display components here are explained using drawing 6 and drawing 7.

[0004] Drawing 6 is drawing showing the cross-section structure of a general liquid crystal display component, and the TFT section which the orientation film and 35 become in a polarizing plate, the color section which 32a becomes in 31a and 31b, and a translucency substrate and 33 become from a color filter, a transparent electrode, etc. in 32b, and 34a and 34b, and a sealant and 37 become from a switching element, a pixel electrode, signal wiring, etc. in a liquid crystal layer and 36, and 38 are spacers.

[0005] Such a liquid crystal display component of a configuration is produced based on the flow chart which consists of a process (a) thru/or a process (o) as shown in drawing 7.

[0006] First, as shown in a process (a) and (e), translucency substrate 32a in which the color section 33 was formed, and translucency substrate 32b in which the TFT section 37 was formed are washed, and these substrates are dried so that it may be shown subsequently to a process (b) and (f).

[0007] Then, as shown in a process (c) and (g), the orientation film 34a and 34b is applied to the forming face of the color section 33 of translucency substrate 32a, and the forming face of the TFT section 37 of translucency substrate 32b, and baking and rubbing processing are performed.

[0008] Furthermore, as shown in a process (d), while forming a sealant 36 in the viewing-area periphery on translucency substrate 32a in which the color section 33 was formed, as shown in a process (h), a spacer 38 is sprinkled to homogeneity on translucency substrate 32b in which the TFT section 37 was formed. In addition, a sealant 36 is not formed in the perimeter of a viewing area, and is not formed in the part used as the inlet of the liquid crystal in a next liquid crystal impregnation process, but prepares opening.

[0009] And as shown in a process (i), as shown in lamination and a process (j), translucency substrate 32a in which the color section 33 and a sealant 36 were formed, and translucency substrate 32b in which the TFT section 37 and the spacer 38 were formed. After performing and carrying out temporary immobilization of the prebaking (temporary baking) processing, with both the *****(ed) substrates 32a and 32b pressed, as shown in a process (k), postbake (this baking) processing is performed.

[0010] Furthermore, as shown in a process (l), both the substrates 32a and 32b *****(ed) if needed are divided in desired magnitude. Hereafter, what was divided by this process is called a cel. Moreover, opening of the sealant 36 prepared in this cel is called an inlet.

[0011] Then, as shown in a process (m), liquid crystal is poured in from the inlet of said cel, and this inlet is closed with closure resin. Furthermore, as shown in a process (n), a cel is heated and quenched so that the liquid crystal injected into the cel if needed may carry out orientation, and as shown in a process (o), a liquid crystal display component completes optical members, such as a polarizing plate, by lamination *****.

[0012]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] By the way, in the manufacture approach of the conventional liquid crystal display component which was mentioned above, about both the substrates 32a and 32b, after *****, since prebaking and postbake processing were needed, the production process became complicated, the fall of a manufacture yield was produced further and there were an increment in plant-and-equipment investment, a fall of production capacity, and a trouble of causing the increment in cost. It is because thermosetting resin is generally used that such prebaking processing and postbake processing are needed as a sealant 36 prepared in one translucency substrate..

[0013] As a sealant 36, it can replace with thermosetting resin and a photo-setting resin can also be used. However, in order to stiffen a photo-setting resin in this case, it is necessary to irradiate UV light but, and when this UV light is irradiated too much by orientation film 34a or 34b formed in the liquid crystal layer 35, translucency substrate 32a, or 32b, a liquid crystal molecule and the orientation film deteriorate and there is a trouble of reducing display grace.

[0014] So, to JP,8-171093,A, as the manufacture approach of a liquid crystal display component of having used the photo-setting resin as a sealant 36, in case UV light is irradiated, the manufacture approach of having the process which light is irradiated [process] alternatively only at a sealant and stiffens a photo-setting resin is indicated. Before the exposure of UV light, a protection-from-light film is covered to the display pattern field except the field corresponding to a sealant, and, specifically, a protection-from-light film is exfoliated after UV light exposure.

[0015] However, according to the technique indicated by JP,8-171093,A, installation of the equipment for sticking or exfoliating a protection-from-light film is needed the process which sticks a protection-from-light film, and the exfoliating process are not only needed, but, and there is a trouble of being obliged to complication of a production process and the increment in plant-and-

equipment investment.

[0016] This invention is made in view of the trouble mentioned above, and offers the liquid crystal display component which does not cause complication of a production process, and the increment in a facility, and its manufacture approach.

[0017]

[Means for Solving the Problem] In the liquid crystal display component which has the configuration with which the flat-surface substrate of a pair maintained the predetermined gap, and, as for the liquid crystal display component of this invention according to claim 1, was *****^(ed) by the sealant prepared around it, and liquid crystal was poured into this gap, even if hardening begins by the exposure of UV light and said sealant intercepts UV light after that, it is characterized by consisting of a photo-setting resin of the optical trigger type which sequential hardening promotes.

[0018] Thus, it can consider as the high liquid crystal display component of display grace, without causing degradation of the liquid crystal ingredient by the exposure of UV light or the orientation film, since the need of irradiating UV light beyond the need by using the resin of an optical trigger type as a photo-setting resin used as a sealant is lost.

[0019] By using the photo-setting resin of an epoxy system as said sealant, the reinforcement of a sealant and elasticity can improve and it can consider as a reliable liquid crystal display component.

[0020] Moreover, this sealant can be formed by easy approaches, such as print processes and the dispenser applying method, by making viscosity of said sealant into 3 - 200 Pa·s.

[0021] The liquid crystal display component of this invention according to claim 4 is set for a liquid crystal display component according to claim 1 to 3. One [said] flat-surface substrate It is the color filter substrate with which stripe-like a transparent electrode and a color filter were formed. The flat-surface substrate of another side The plasma room in which plasma discharge is possible is the plasma address substrate formed in the shape of a stripe, and it is characterized by *****^(ing) so that a transparent electrode and a plasma room may intersect perpendicularly the flat-surface substrate of these pairs. [many]

[0022] Thus, since it is applicable also to the liquid crystal display component of the plasma address type which enables a big screen display, it becomes possible to produce the display device of a big screen easily.

[0023] The manufacture approach of the liquid crystal display component of this invention according to claim 5 The process which applies to it the photo-setting resin of the optical trigger type which sequential hardening promotes among the flat-surface substrates of a pair even if hardening begins to the periphery of one [at least] substrate and it intercepts UV light to it after that by the exposure of UV light, UV light is irradiated through said photo-setting resin in an instant at the substrate of the pair *****^(ed) with lamination ***** in the flat-surface substrate of a pair, and it is characterized by having the process which stiffens said photo-setting resin.

[0024] Therefore, in order for UV light to prevent the orientation film irradiating too much, the need of using a protection-from-light mask etc. is lost, and it becomes possible to avoid complication of a production process.

[0025]

[Embodiment of the Invention] (Gestalt 1 of operation) The 1st operation gestalt of this invention is explained below using drawing 1 and drawing 2 . This operation gestalt explains the liquid crystal display component of the TFT drive mold which performs an active drive using the switching element which consists of TFT.

[0026] Drawing 1 is drawing showing the cross-section structure of the liquid crystal display component of a common TFT drive mold, and the TFT section which the orientation film and 5 become in the color section which a translucency substrate and 3 become [1a and 1b] from a color filter, a transparent electrode, etc. in a polarizing plate, 2a, and 2b, and 4a and 4b, and a sealant and 7 become from a switching element, a pixel electrode, signal wiring, etc. in a liquid crystal layer and 6, and 8 are spacers.

[0027] The photo-setting resin of the optical trigger type which hardening begins and carries out sequential hardening after that by the exposure of the sealant 6 used for this operation gestalt and UV light is used. Hardening is started only by irradiating UV light in an instant, and even if the photo-setting resin of this optical trigger type stops the exposure of UV light after that, sequential hardening promotes it. Therefore, in order to stiffen this resin, the irradiation time of UV light is good at very slight time amount, for example, the time amount for about 2 - 5 seconds. If the irradiation time of UV light is 10 or less seconds, the orientation film or a liquid crystal ingredient will not deteriorate, so that it reduces display grace.

[0028] Such a liquid crystal display component of a configuration is produced based on the flow chart which consists of a process (a) thru/or a process (m) as shown in drawing 2 .

[0029] First, as shown in a process (a) and (e), neutral detergent washing, pure-water washing, ultrasonic cleaning, etc. wash translucency substrate 2b in which translucency substrate 2a and the TFT section 7 in which the color section 3 was formed were formed, and these substrates are dried so that it may be shown subsequently to a process (b) and (f).

[0030] Then, as shown in a process (c) and (g), the orientation film 4a and 4b is applied to the forming face of the color section 3 of translucency substrate 2a, and the forming face of the TFT section 7 of translucency substrate 2b, and baking and rubbing processing are performed.

[0031] Furthermore, as shown in a process (d), while forming a sealant 6 in the viewing-area periphery on translucency substrate 2a in which the color section 3 was formed, as shown in a process (h), a spacer 8 is sprinkled to homogeneity on translucency substrate 2b in which the TFT section 7 was formed. In addition, a sealant 6 is not formed in the perimeter of a viewing area, and is not formed in the part used as the inlet of the liquid crystal in a next liquid crystal impregnation process, but prepares opening.

[0032] In addition, it is more desirable to form what was beforehand patternized using print processes, such as screen-stencil, flexographic printing, and offset printing, for reduction of cost or a routing counter on direct translucency substrate 2a, or to draw on direct translucency substrate 2a by the dispenser applying method, although patterning of it may be carried out after forming said sealant 6 the whole surface on translucency substrate 2a. When using these approaches, the viscosity of a sealant 6 is good to use the thing of 3 - 200 Pa·s. This is for faults, like formation by easy approaches, such as that a seal width spreads, that bond strength falls, print processes, and the dispenser applying method, becomes difficult to arise, when viscosity separates from this range.

[0033] Moreover, if the photo-setting resin of the epoxy system which was excellent in reinforcement and elasticity as said sealant 6 is used, the resistance to environment of a liquid crystal display component will improve.

[0034] Next, as shown in a process (i), UV light is irradiated in an instant from the translucency substrate 2b side by which the TFT section 7 was formed in ***** and coincidence in translucency substrate 2a in which the sealant 6 was formed, and translucency substrate 2b in which the TFT section 7 was formed, and a sealant 6 is stiffened.

[0035] Furthermore, as shown in a process (j), both substrates 2a *****^(ed) if needed and 2b are divided in desired magnitude.

Hereafter, what was divided by this process is called a cel. Moreover, opening of the sealant 6 prepared in this cel is called an inlet.

[0036] Then, as shown in a process (k), liquid crystal is poured in from the inlet of said cel, and this inlet is closed with closure resin. Furthermore, as shown in a process (l), a cel is heated and quenched so that the liquid crystal injected into the cel if needed may carry out orientation, and as shown in a process (m), the liquid crystal display component of a TFT drive mold completes optical members, such as a polarizing plate, by lamination *****.

[0037] Thus, the liquid crystal display component of a TFT mold can be obtained easily, without complicating a production process, since according to the liquid crystal display component in this operation gestalt the protection-from-light mask for not needing the prebaking process and the postbake process of requiring a long time, and interrupting UV light to an effective viewing area is not needed in order to stiffen a sealant 6.

[0038] (Gestalt 2 of operation) The 2nd operation gestalt of this invention is explained below using drawing 3, drawing 4, and drawing 5. This operation gestalt explains the liquid crystal display component of the plasma address type which performs an active drive using plasma discharge.

[0039] Drawing 3 is drawing showing the cross-section structure of the liquid crystal display component of a common plasma address type, and, for the orientation film and 15, as for a sealant and 17, a liquid crystal layer and 16 are [the color section which a polarizing plate becomes in 11a and 11b, and a translucency substrate and 13 become from a color filter, a transparent electrode, etc. in 12, and 14a and 14b / a plasma address substrate and 18] spacers.

[0040] With this operation gestalt, as a plasma address substrate 17, as shown in drawing 4, the cathode electrode 22, the anode electrode 23, and the septum 24 were formed in the shape of a stripe on the translucency substrate 21, and that by which the translucency sheet metal substrate 25 was formed on the septum 24 was used.

[0041] In drawing 4, the space surrounded by the translucency substrate 21, the septum 24, and the translucency sheet metal substrate 25 serves as a plasma room, and a majority of these plasma rooms are formed in the shape of a stripe. Moreover, the transparent electrode prepared as the color section 13 on the translucency substrate 12 is also formed in the shape of a stripe, and the translucency substrate 2 and the plasma address substrate 17 are ***** (ed) so that a transparent electrode and a plasma room may intersect perpendicularly.

[0042] The photo-setting resin of the optical trigger type which hardening begins and carries out sequential hardening after that by the exposure of UV light like the 1st operation gestalt is used for the sealant 16 used for this operation gestalt.

[0043] Such a liquid crystal display component of a configuration is produced based on the flow chart which consists of a process (a) thru/or a process (m) as shown in drawing 5.

[0044] First, as shown in a process (a) and (e), neutral detergent washing, pure-water washing, ultrasonic cleaning, etc. wash translucency substrate 12a and the plasma address substrate 17 with which the color section 13 was formed, and these substrates are dried so that it may be shown subsequently to a process (b) and (f).

[0045] Then, as shown in a process (c) and (g), the orientation film 14a and 14b is applied to the forming face [of the color section 13 of translucency substrate 12a], and translucency thin film substrate 25 side of the plasma address substrate 17, and baking and rubbing processing are performed.

[0046] Furthermore, as shown in a process (d), while forming a sealant 16 in the viewing-area periphery on translucency substrate 12a in which the color section 3 was formed, as shown in a process (h), a spacer 18 is sprinkled to homogeneity on the plasma address substrate 17. In addition, a sealant 16 is not formed in the perimeter of a viewing area, and is not formed in the part used as the inlet of the liquid crystal in a next liquid crystal impregnation process, but prepares opening.

[0047] In addition, it is more desirable to form using print processes or the dispenser applying method like the 1st operation gestalt, although patterning of it may be carried out after forming said sealant 16 all over a substrate 12a top.

[0048] Moreover, if the photo-setting resin of the epoxy system which was excellent in reinforcement and elasticity as said sealant 16 is used, the resistance to environment of a liquid crystal display component will improve.

[0049] And as shown in a process (i), translucency substrate 12a in which the color section 13 and a sealant 16 were formed, and the plasma address substrate 17 with which the spacer 18 was formed are irradiated at ***** and coincidence, UV light is irradiated from the plasma address substrate 17 side in an instant, and a sealant 16 is stiffened.

[0050] Furthermore, as shown in a process (j), translucency substrate 12a and the plasma address substrate 17 which were ***** (ed) if needed are divided in desired magnitude. Hereafter, what was divided by this process is called a cel. Moreover, opening of the sealant 16 prepared in this cel is called an inlet.

[0051] Then, as shown in a process (k), liquid crystal is poured in from the inlet of said cel, and this inlet is closed with closure resin. Furthermore, as shown in a process (l), a cel is heated and quenched so that the liquid crystal injected into the cel if needed may carry out orientation, and as shown in a process (m), the liquid crystal display component of a plasma address type completes optical members, such as a polarizing plate, by lamination *****.

[0052] Thus, the liquid crystal display component of a plasma address type can be obtained easily, without complicating a production process, since according to the liquid crystal display component in this operation gestalt the protection-from-light mask for not needing the prebaking process and the postbake process of requiring a long time, and interrupting UV light to an effective viewing area is not needed in order to stiffen a sealant 16.

[0053]

[Effect of the Invention] As explained above, the liquid crystal display component by this invention By using the sealant which consists of a photo-setting resin of the optical trigger type which sequential hardening promotes even if hardening begins and it intercepts UV light after that by the exposure of UV light The need of irradiating UV light beyond the need is lost, and the effectiveness that it can consider as the liquid crystal display component which cannot cause degradation of the orientation film by the exposure of UV light, and can be manufactured easily is done so.

[0054] Moreover, by using the photo-setting resin of an epoxy system as said sealant, the reinforcement of a sealant and elasticity improve and the effectiveness that it can consider as a reliable liquid crystal display component is done so.

[0055] Furthermore, this sealant can be formed by easy approaches, such as print processes and the dispenser applying method, by making viscosity of said sealant into 3 - 200 Pa·s.

[0056] Moreover, when it considers as the liquid crystal display component of a plasma address type especially as the above-mentioned liquid crystal display component, the effectiveness that the display device of a big screen is easily producible is done so.

[0057] The manufacture approach of the liquid crystal display component of this invention among the flat-surface substrates of a pair to the periphery of one [at least] substrate The process which applies the photo-setting resin of the optical trigger type

which sequential hardening promotes even if hardening begins and it intercepts UV light after that by the exposure of UV light. Since it has the process which UV light is irradiated [process] through said photo-setting resin in an instant at the substrate of the pair ******(ed) with lamination ***** in the flat-surface substrate of a pair, and stiffens said photo-setting resin In order for UV light to prevent the orientation film irradiating too much, the need of using a protection-from-light mask etc. is lost, and the effectiveness that complication of a production process is avoidable is done so.

.....
[Translation done.]

* NOTICES *

JP0 and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is the sectional view of the liquid crystal display component in the operation gestalt 1.

[Drawing 2] It is the flow Fig. showing the production process of the liquid crystal display component shown in drawing 1.

[Drawing 3] It is the sectional view of the liquid crystal display component in the operation gestalt 2.

[Drawing 4] It is the detail sectional view of the plasma address substrate 17 in drawing 3.

[Drawing 5] It is the flow Fig. showing the production process of the liquid crystal display component shown in drawing 3.

[Drawing 6] It is the sectional view of the conventional liquid crystal display component.

[Drawing 7] It is the flow Fig. showing the production process of the liquid crystal display component shown in drawing 6.

[Description of Notations]

1a, 1b, 11a, 11b Polarizing plate

12 2a, 2b, 21 Translucency substrate

3 13 Color section

4a, 4b, 14a, 14b Orientation film

5 15 Liquid crystal layer

6 16 Sealant

7 The TFT Section

8 18 Spacer

17 Plasma Address Substrate

22 Cathode Electrode

23 Anode Electrode

24 Septum

25 Translucency Sheet Metal Substrate

[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-183918

(43)公開日 平成11年(1999)7月9日

(51)Int.Cl.⁶
G 0 2 F 1/1339識別記号
5 0 5F I
G 0 2 F 1/1339 5 0 5

審査請求 未請求 請求項の数 5 O.L. (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平9-356476

(22)出願日

平成9年(1997)12月25日

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 中山 純一郎

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

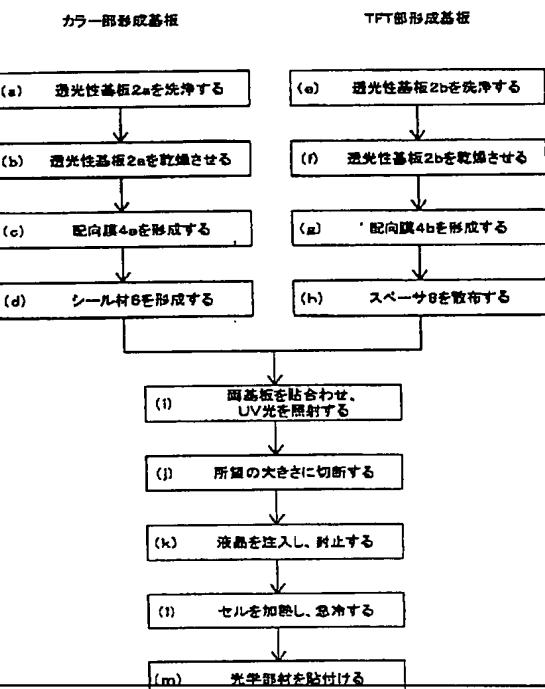
(74)代理人 弁理士 小池 隆彌

(54)【発明の名称】 液晶表示素子及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 製造工程数を大幅に減少させることができるとなる液晶表示素子及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 一対の電極基板を貼合わせる際に、シール材としてUV光の照射によって硬化が開始し、その後順次硬化する光トリガ式の光硬化性樹脂を用いる。これによって、熟硬化性樹脂を用いた場合のように長時間をする焼成工程をなくすことができると共に、過度のUV照射による配向膜の劣化を防ぐ為の遮光手段もなくすことができる。



(2)

特開平11-183918

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の平面基板が、その周辺に設けられたシール材によって所定の間隙を保って貼合わされ、該間隙に液晶が注入された構成を有する液晶表示素子において、前記シール材が、UV光の照射によって硬化が開始し、その後UV光を遮断しても順次硬化が促進する光トリガ式の光硬化性樹脂からなることを特徴とする液晶表示素子。

【請求項2】 前記シール材は、エポキシ系の光硬化性樹脂であることを特徴とする請求項1記載の液晶表示素子。

【請求項3】 前記シール材は、粘度が3～200Pa・sであることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の液晶表示素子。

【請求項4】 前記一方の平面基板は、ストライプ状の透明電極とカラーフィルタとが形成されたカラーフィルタ基板であり、他方の平面基板は、プラズマ放電可能なプラズマ室がストライプ状に多数形成されたプラズマアドレス基板であり、これら一対の平面基板が、透明電極とプラズマ室とが直交するように貼合わされていることを特徴とする請求項1乃至3記載の液晶表示素子。

【請求項5】 一対の平面基板のうち少なくとも一方の基板の周辺部に、UV光の照射によって硬化が開始し、その後UV光を遮断しても順次硬化が促進する光トリガ式の光硬化性樹脂を塗布する工程と、前記光硬化性樹脂を介して一対の平面基板を貼合わせる工程と、貼合わされた一対の基板にUV光を瞬時に照射し、前記光硬化性樹脂を硬化させる工程と、を有することを特徴とする液晶表示素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、フラットパネルディスプレイとして好適に用いられる液晶表示素子およびその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 フラットパネルディスプレイに用いられる液晶表示素子の開発は、小型化、単色化、2値表示化の初期段階を既に脱し、大型化、カラー化、中間調表示や動画表示などに進展して年々にその生産量も増加の一途を辿っている。

【0003】 ここで、液晶表示素子の一つとして TFT からなるスイッチング素子を有するアクティブマトリクス型の液晶表示素子の構造及びその製造方法について、図6、図7を用いて説明すると以下の通りである。

【0004】 図6は一般的な液晶表示素子の断面構造を示す図であり、31a、31bは偏光板、32a、32bは透光性基板、33はカラーフィルタや透明電極などからなるカラーパーツ、34a、34bは配向膜、35は液晶層、36はシール材、37はスイッチング素子、画素

2
電極及び信号配線などからなるTFT部、38はスペーサである。

【0005】 このような構成の液晶表示素子は、図7に示すような、工程(a)乃至工程(o)からなるフローチャートに基づいて作製される。

【0006】 まず、工程(a)及び(e)に示されるように、カラーパーツ33が形成された透光性基板32a及びTFT部37が形成された透光性基板32bを洗浄し、次いで工程(b)及び(f)に示されるように、これららの基板を乾燥させる。

【0007】 続いて、工程(c)、(g)に示されるように、透光性基板32aのカラーパーツ33の形成面、及び透光性基板32bのTFT部37の形成面に配向膜34a、34bを塗布し、焼成、ラビング処理を行う。

【0008】 更に、工程(d)に示されるように、カラーパーツ33が形成された透光性基板32a上の表示領域周辺部にシール材36を形成すると共に、工程(h)に示されるように、TFT部37が形成された透光性基板32b上にスペーサ38を均一に散布する。なお、シール材36は表示領域の全周に形成するのではなく、後の液晶注入工程における液晶の注入口となる部分には形成せず、開口部を設けておく。

【0009】 そして、工程(i)に示されるように、カラーパーツ33及びシール材36が設けられた透光性基板32aと、TFT部37及びスペーサ38が設けられた透光性基板32bとを貼合わせ、工程(j)に示されるように、貼合わされた両基板32a、32bをプレスしたままプリベーク(仮焼成)処理を行って仮固定させた後、工程(k)に示されるように、ポストベーク(本焼成)処理を行う。

【0010】 更に、工程(l)に示されるように、必要に応じて貼合わされた両基板32a、32bを所望の大きさに分断する。以下、この工程により分断されたものをセルと称する。また、このセル内に設けられたシール材36の開口部を注入口と称する。

【0011】 続いて、工程(m)に示されるように、前記セルの注入口から液晶を注入し、この注入口を封止樹脂により封止する。更に、工程(n)に示されるように、必要に応じてセルに注入された液晶が配向するようにセルを加熱・急冷し、工程(o)に示されるように偏光板などの光学部材を貼合わせることによって液晶表示素子が完成する。

【0012】

【発明が解決しようとする課題】 ところで、上述したような従来の液晶表示素子の製造方法においては、両基板32a及び32bを貼合わせた後、プリベーク及びポストベーク処理を必要とするため製造工程が複雑になり、設備投資の増加、生産能力の低下、更には製造歩留の低下を生じてしまい、コストの増加を招いてしまうという問題点があった。このようなプリベーク処理及びポス

(3)

特開平11-183918

3

ベーク処理が必要となるのは、一方の透光性基板に設けられるシール材36として、一般的に熱硬化性樹脂が用いられている為である。

【0013】シール材36としては、熱硬化性樹脂に代えて光硬化性樹脂を用いることもできる。しかしこの場合、光硬化性樹脂を硬化させる為にUV光を照射する必要があるが、このUV光が液晶層35や、透光性基板32a又は32bに形成された配向膜34a又は34bに過度に照射されると、液晶分子や配向膜が劣化してしまい、表示品位を低下させてしまうという問題点がある。

【0014】そこで、特開平8-171093号公報には、シール材36として光硬化性樹脂を用いた液晶表示素子の製造方法として、UV光を照射する際にシール材にのみ選択的に光を照射して光硬化性樹脂を硬化させる工程を有する製造方法を開示している。具体的には、UV光の照射前に遮光フィルムをシール材対応領域を除く表示パターン領域に被覆し、UV光照射後に遮光フィルムを剥離するものである。

【0015】しかしながら、特開平8-171093号公報に開示された技術によれば、遮光フィルムを貼付する工程及び剥離する工程が必要となるばかりでなく、遮光フィルムを貼付又は剥離する為の装置の導入も必要となり、製造工程の複雑化、設備投資の増加を余儀なくされてしまうという問題点がある。

【0016】本発明は上述した問題点に鑑みてなされたものであり、製造工程の複雑化及び設備の増加を招くことのない液晶表示素子及びその製造方法を提供するものである。

【0017】

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1記載の液晶表示素子は、一対の平面基板が、その周辺に設けられたシール材によって所定の間隙を保って貼合わされ、該間隙に液晶が注入された構成を有する液晶表示素子において、前記シール材が、UV光の照射によって硬化が開始し、その後UV光を遮断しても順次硬化が促進する光トリガ式の光硬化性樹脂からなることを特徴とするものである。

【0018】このように、シール材として用いる光硬化性樹脂として光トリガ式の樹脂を用いることによって、必要以上にUV光を照射する必要が無くなるので、UV光の照射による液晶材料又は配向膜の劣化を起こすことなく、表示品位の高い液晶表示素子とすることができる。

【0019】前記シール材としてエポキシ系の光硬化性樹脂を用いることによって、シール材の強度、伸縮性が向上し、信頼性の高い液晶表示素子とすることができる。

【0020】また、前記シール材の粘度を3~200Pa·sとすることによって、該シール材を印刷法やディスペンサ塗布法等の簡単な方法で形成することができ

4

る。

【0021】本発明の請求項4記載の液晶表示素子は、請求項1乃至3記載の液晶表示素子において、前記一方の平面基板は、ストライプ状の透明電極とカラーフィルタとが形成されたカラーフィルタ基板であり、他方の平面基板は、プラズマ放電可能なプラズマ室がストライプ状に多数形成されたプラズマアドレス基板であり、これら一対の平面基板を、透明電極とプラズマ室とが直交するように貼合わされていることを特徴とするものである。

【0022】このように、大画面表示を可能とするプラズマアドレス型の液晶表示素子にも適用することができるので、大画面の表示素子を容易に作製することが可能となる。

【0023】本発明の請求項5記載の液晶表示素子の製造方法は、一対の平面基板のうち少なくとも一方の基板の周辺部に、UV光の照射によって硬化が開始し、その後UV光を遮断しても順次硬化が促進する光トリガ式の光硬化性樹脂を塗布する工程と、前記光硬化性樹脂を介して一対の平面基板を貼合わせる工程と、貼合わされた一対の基板にUV光を瞬時に照射し、前記光硬化性樹脂を硬化させる工程と、を有することを特徴とするものである。

【0024】したがって、UV光が配向膜に過度に照射されることを防ぐ為に遮光マスク等を用いる必要が無くなり、製造工程の複雑化を避けることが可能となる。

【0025】

【発明の実施の形態】(実施の形態1) 本発明の第1の実施形態について、図1、図2を用いて以下に説明する。本実施形態は、TFTからなるスイッチング素子を用いてアクティブ駆動を行うTFT駆動型の液晶表示素子について説明したものである。

【0026】図1は一般的なTFT駆動型の液晶表示素子の断面構造を示す図であり、1a、1bは偏光板、2a、2bは透光性基板、3はカラーフィルタや透明電極などからなるカラー部、4a、4bは配向膜、5は液晶層、6はシール材、7はスイッチング素子、画素電極及び信号配線などからなるTFT部、8はスペーサである。

【0027】本実施形態に用いられるシール材6は、UV光の照射によって硬化が開始し、その後順次硬化する光トリガ式の光硬化性樹脂を用いている。この光トリガ式の光硬化性樹脂は、UV光を瞬時に照射しただけで硬化が開始され、その後UV光の照射を止めても順次硬化が促進するものである。したがって、この樹脂を硬化させる為にはUV光の照射時間はごく僅かな時間、例えば2~5秒程度の時間で良い。UV光の照射時間が10秒以下であれば、配向膜又は液晶材料が表示品位を低下させるほど劣化することはない。

【0028】このような構成の液晶表示素子は、図2に

(4)

特開平11-183918

5

示すような、工程 (a) 乃至工程 (m) からなるフローチャートに基づいて作製される。

【0029】まず、工程 (a) 及び (e) に示されるように、カラー部 3 が形成された透光性基板 2 a 及び TFT 部 7 が形成された透光性基板 2 b を中性洗剤洗浄、純水洗浄、超音波洗浄などにより洗浄し、次いで工程 (b) 及び (f) に示されるように、これらの基板を乾燥させる。

【0030】続いて、工程 (c)、(g) に示されるように、透光性基板 2 a のカラー部 3 の形成面、及び透光性基板 2 b の TFT 部 7 の形成面に配向膜 4 a、4 b を塗布し、焼成、ラビング処理を行う。

【0031】更に、工程 (d) に示されるように、カラー部 3 が形成された透光性基板 2 a 上の表示領域周辺部にシール材 6 を形成すると共に、工程 (h) に示されるように、TFT 部 7 が形成された透光性基板 2 b 上にスペーサ 8 を均一に散布する。なお、シール材 6 は表示領域の全周に形成するのではなく、後の液晶注入工程における液晶の注入口となる部分には形成せず、開口部を設けておく。

【0032】なお、前記シール材 6 は、透光性基板 2 a 上の全面に形成した後パターニングしても良いが、コストや工程数の削減の為には、スクリーン印刷、フレキソ印刷、オフセット印刷などの印刷法を用いて予めパターン化されたものを直接透光性基板 2 a 上に形成する、或いはディスペンサ塗布法によって直接透光性基板 2 a 上に描画するほうが好ましい。これらの方法を用いる場合は、シール材 6 の粘度は 3~200 Pa·s のものを用いると良い。これは、粘度がこの範囲から外れてしまうとシール幅が広がってしまうこと、接着強度が低下すること、印刷法やディスペンサ塗布法などの簡単な方法での形成が困難になること等の不具合が生じてしまう為である。

【0033】また、前記シール材 6 として強度、伸縮性に優れたエポキシ系の光硬化性樹脂を用いれば、液晶表示素子の耐環境性が向上する。

【0034】次に、工程 (i) に示されるように、シール材 6 が形成された透光性基板 2 a と TFT 部 7 が形成された透光性基板 2 b とを貼合わせると同時に、TFT 部 7 が形成された透光性基板 2 b 側から UV 光を瞬時に照射し、シール材 6 を硬化させる。

【0035】更に、工程 (j) に示されるように、必要に応じて貼合わされた両基板 2 a、2 b を所望の大きさに分断する。以下、この工程により分断されたものをセルと称する。又、このセル内に設けられたシール材 6 の開口部を注入口と称する。

【0036】続いて、工程 (k) に示されるように、前記セルの注入口から液晶を注入し、この注入口を封止樹脂により封止する。更に、工程 (l) に示されるように、必要に応じてセルに注入された液晶が配向するよう

6

にセルを加熱・急冷し、工程 (m) に示されるように偏光板などの光学部材を貼合わせることによって、TFT 駆動型の液晶表示素子が完成する。

【0037】このように、本実施形態における液晶表示素子によれば、シール材 6 を硬化させる為に長時間を要するプリベーク工程及びポストベーク工程を必要とすることが無く、且つ有効表示領域への UV 光を遮る為の遮光マスクを必要とすることも無いので、製造工程を複雑にすること無く、容易に TFT 型の液晶表示素子を得ることができる。

【0038】(実施の形態 2) 本発明の第 2 の実施形態について、図 3、図 4、図 5 を用いて以下に説明する。本実施形態は、プラズマ放電を利用してアクティブ駆動を行なうプラズマアドレス型の液晶表示素子について説明したものである。

【0039】図 3 は一般的なプラズマアドレス型の液晶表示素子の断面構造を示す図であり、11a、11b は偏光板、12 は透光性基板、13 はカラーフィルタや透明電極などからなるカラー部、14a、14b は配向膜、15 は液晶層、16 はシール材、17 はプラズマアドレス基板、18 はスペーサである。

【0040】本実施形態では、プラズマアドレス基板 17 として、図 4 に示すように、透光性基板 21 上にカソード電極 22、アノード電極 23、及び隔壁 24 がストライプ状に形成され、隔壁 24 上に透光性薄板基板 25 が設けられたものを用いた。

【0041】図 4 において、透光性基板 21、隔壁 24、および透光性薄板基板 25 によって囲まれた空間がプラズマ室となり、このプラズマ室はストライプ状に多数形成されている。また、透光性基板 12 上にカラー部 13 として設けられた透明電極もストライプ状に形成されており、透光性基板 2 およびプラズマアドレス基板 17 は、透明電極とプラズマ室とが直交するように貼合せられている。

【0042】本実施形態に用いられるシール材 16 は、第 1 の実施形態と同様に、UV 光の照射によって硬化が開始し、その後順次硬化する光トリガ式の光硬化性樹脂を用いている。

【0043】このような構成の液晶表示素子は、図 5 に示すような、工程 (a) 乃至工程 (m) からなるフローチャートに基づいて作製される。

【0044】まず、工程 (a) 及び (e) に示されるように、カラー部 13 が形成された透光性基板 12a 及びプラズマアドレス基板 17 を中性洗剤洗浄、純水洗浄、超音波洗浄などにより洗浄し、次いで工程 (b) 及び (f) に示されるように、これらの基板を乾燥させる。

【0045】続いて、工程 (c)、(g) に示されるように、透光性基板 12a のカラー部 13 の形成面側、及びプラズマアドレス基板 17 の透光性薄板基板 25 側に配向膜 14a、14b を塗布し、焼成、ラビング処理を

50

(5)

特開平11-183918

7

8

行う。

【0046】更に、工程 (d) に示されるように、カラ一部 3 が形成された透光性基板 12a 上の表示領域周辺部にシール材 16 を形成すると共に、工程 (h) に示されるように、プラズマアドレス基板 17 上にスペーサ 18 を均一に散布する。なお、シール材 16 は表示領域の全周に形成するのではなく、後の液晶注入工程における液晶の注入口となる部分には形成せず、開口部を設けておく。

【0047】なお、前記シール材 16 は、基板 12a 上全面に形成した後パターニングしても良いが、第 1 の実施形態と同様に印刷法或いはディスペンサ塗布法を用いて形成するほうが好ましい。

【0048】また、前記シール材 16 として強度、伸縮性に優れたエポキシ系の光硬化性樹脂を用いれば、液晶表示素子の耐環境性が向上する。

【0049】そして、工程 (i) に示されるように、カラ一部 13 及びシール材 16 が設けられた透光性基板 12a と、スペーサ 18 が設けられたプラズマアドレス基板 17 とを貼合わせると同時に、プラズマアドレス基板 17 側から UV 光を瞬時に照射し、シール材 16 を硬化させる。

【0050】更に、工程 (j) に示されるように、必要に応じて貼合わされた透光性基板 12a 及びプラズマアドレス基板 17 を所望の大きさに分断する。以下、この工程により分断されたものをセルと称する。また、このセル内に設けられたシール材 16 の開口部を注入口と称する。

【0051】続いて、工程 (k) に示されるように、前記セルの注入口から液晶を注入し、この注入口を封止樹脂により封止する。更に、工程 (l) に示されるように、必要に応じてセルに注入された液晶が配向するようにセルを加熱・急冷し、工程 (m) に示されるように偏光板などの光学部材を貼合わせることによって、プラズマアドレス型の液晶表示素子が完成する。

【0052】このように、本実施形態における液晶表示素子によれば、シール材 16 を硬化させるために長時間をするプリベーク工程及びポストベーク工程を必要とすることが無く、且つ有効表示領域への UV 光を遮る為の遮光マスクを必要とすることも無いので、製造工程を複雑にすること無く、容易にプラズマアドレス型の液晶表示素子を得ることができる。

【0053】

【発明の効果】以上説明したように、本発明による液晶表示素子は、UV 光の照射によって硬化が開始し、その後 UV 光を遮断しても順次硬化が促進する光トリガ式の光硬化性樹脂からなるシール材を用いることによって、必要以上に UV 光を照射する必要が無くなり、UV 光の照射による配向膜の劣化を起こすことがなく、容易に製造することができる液晶表示素子とすることができます。

いう効果を奏する。

【0054】また、前記シール材としてエポキシ系の光硬化性樹脂を用いることによって、シール材の強度、伸縮性が向上し、信頼性の高い液晶表示素子とすることができますという効果を奏する。

【0055】更に、前記シール材の粘度を 3 ~ 200Pa・s とすることによって、該シール材を印刷法やディスペンサ塗布法等の簡単な方法で形成することができる。

【0056】また、上記液晶表示素子として特にプラズマアドレス型の液晶表示素子とした場合には、大画面の表示素子を容易に作製することができるという効果を奏する。

【0057】本発明の液晶表示素子の製造方法は、一対の平面基板のうち少なくとも一方の基板の周辺部に、UV 光の照射によって硬化が開始し、その後 UV 光を遮断しても順次硬化が促進する光トリガ式の光硬化性樹脂を塗布する工程と、前記光硬化性樹脂を介して一対の平面基板を貼合わせる工程と、貼合わされた一対の基板に UV 光を瞬時に照射し、前記光硬化性樹脂を硬化させる工程と、を有しているので、UV 光が配向膜に過度に照射されることを防ぐ為に遮光マスク等を用いる必要が無くなり、製造工程の複雑化を避けることができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図 1】実施形態 1 における液晶表示素子の断面図である。

【図 2】図 1 に示す液晶表示素子の製造工程を示すフローレンスである。

【図 3】実施形態 2 における液晶表示素子の断面図である。

【図 4】図 3 におけるプラズマアドレス基板 17 の詳細断面図である。

【図 5】図 3 に示す液晶表示素子の製造工程を示すフローレンスである。

【図 6】従来の液晶表示素子の断面図である。

【図 7】図 6 に示す液晶表示素子の製造工程を示すフローレンスである。

【符号の説明】

40	1a、1b、11a、11b	偏光板
	2a、2b、12、21	透光性基板
	3、13	カラ一部
	4a、4b、14a、14b	配向膜
	5、15	液晶層
	6、16	シール材
	7	TFT 部
	8、18	スペーサ
	17	プラズマアドレス基板
	22	カソード電極
	50 23	アノード電極

24 隔壁

9

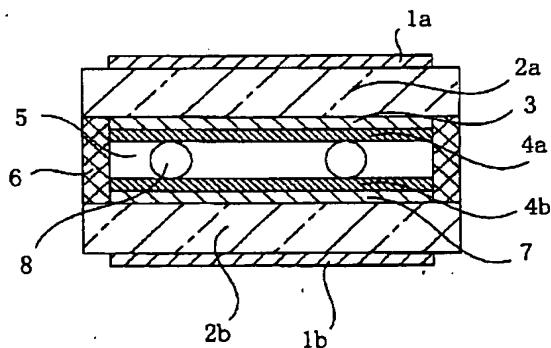
(6)

特開平11-183918

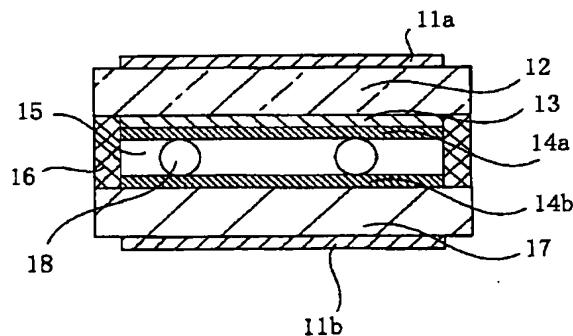
10

25 透光性薄板基板

【図1】



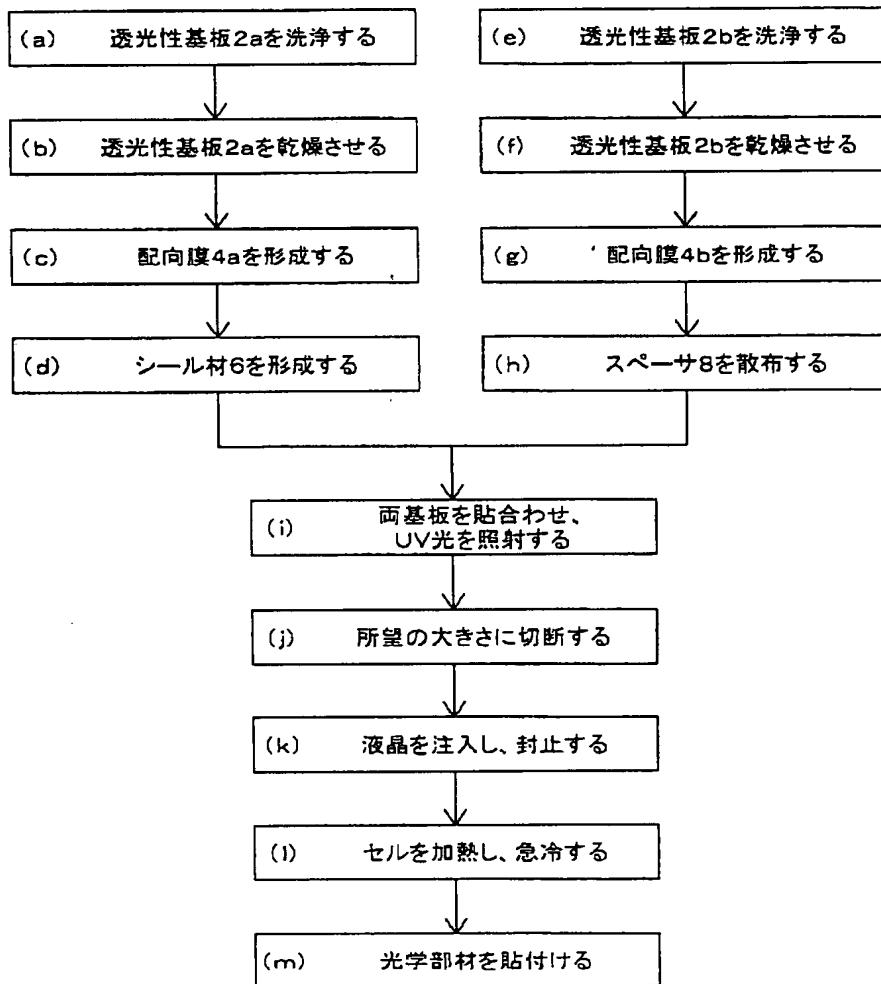
【図3】



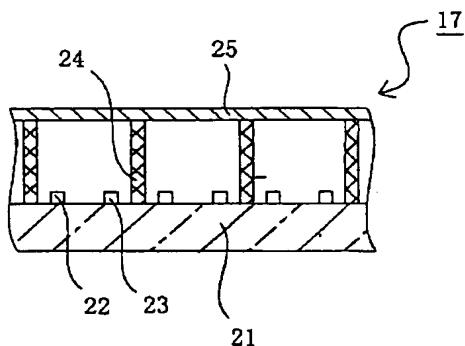
【図2】

カラ一部形成基板

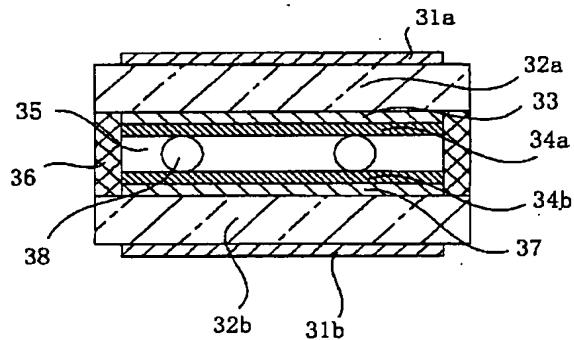
TFT部形成基板



【図4】



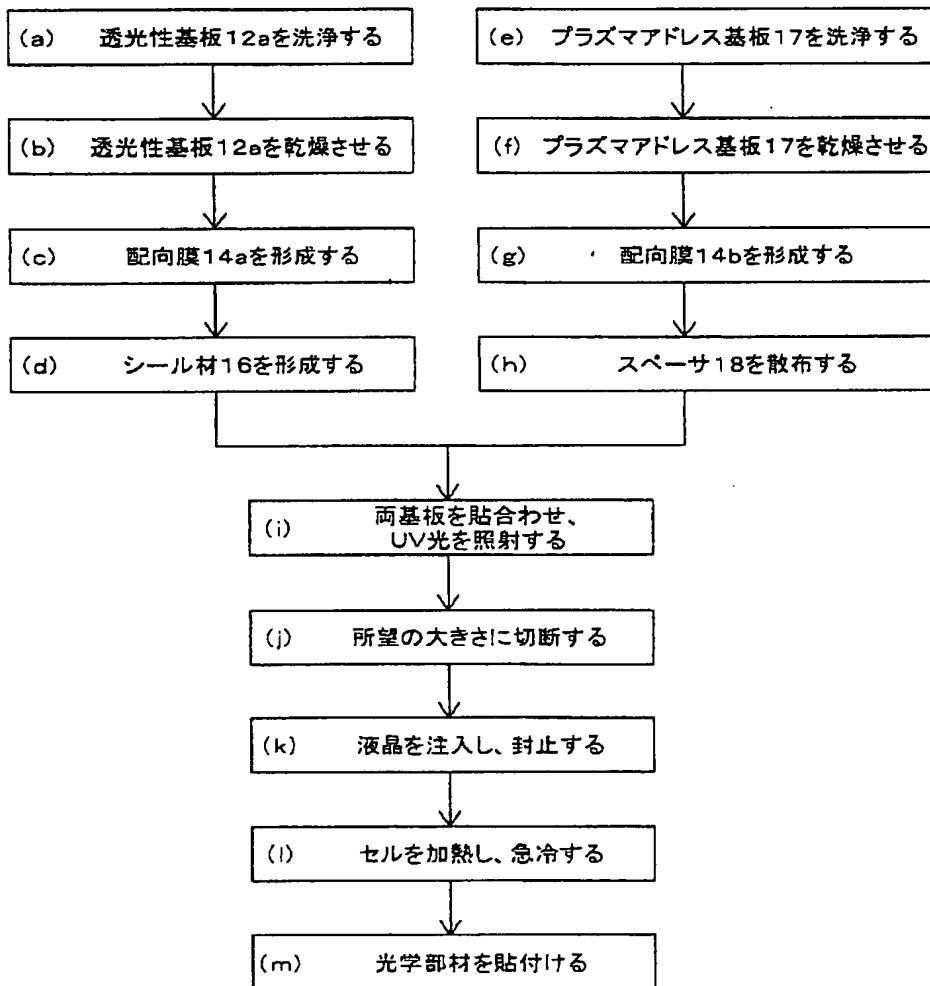
【図6】



【図5】

カラー部形成基板

プラズマアドレス基板



【図7】

